Record Display Form Page 1 of 1

First Hit Previous Doc Next Doc Go to Doc#

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 2 File: JPAB Jan 28, 1985

PUB-NO: JP360017092A

DOCUMENT-IDENTIFIER: <u>JP 60017092 A</u>
TITLE: ADDITIVE FOR MAT ZINCIFICATION

PUBN-DATE: January 28, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

IHARA, YASUO TAKAHASHI, AKIO IGARASHI, TOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

DEITSUPUSOOLE KK

APPL-NO: JP58125352 APPL-DATE: July 8, 1983

US-CL-CURRENT: 205/310INT-CL (IPC): C25D 3/22

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a mat zincified surface having superior rust preventing power by adding an additive consisting of a quaternized amine polymer and a quaternized imidazole deriv. each represented by a specified formula to an alkaline electrolytic zincifying soln.

CONSTITUTION: An additive is prepd. by mixing a quaternized amine polymer represented by formula I (where R1 is $1{\sim}5C$ alkyl, a group represented by formula IIor -CH2CH2OCH2CH2-, X- is a halogen ion, and n is $5{\sim}150$ degree of polym.) with a quaternized imidazole deriv. represented by formula III (where each of R2 and R3 is $1{\sim}5C$ alkyl, benzyl or HO(CH2)m, m is an integer of $1{\sim}6$, and X- is a halogen ion). The prepd. additive is added to an alkaline electrolytic zincifying soln. The concn. of the amine polymer in the soln. is $50{\sim}1,000$ mg/l, and that of the imidazole deriv. is $0.1{\sim}5g/1$.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set



L1: Entry 2 of 2

File: DWPI

Jan 28, 1985

DERWENT-ACC-NO: 1985-059818

DERWENT-WEEK: 198510

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Delustering additive for alkaline zinc electroplating soln. - comprises

quat. amine polymer and a imidazole deriv

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

DIPSOL KK

DIPSN

PRIORITY-DATA: 1983JP-0125352 (July 8, 1983)

...Search Selected Search ALL

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 60017092 A

January 28, 1985

004

JP 88009594 B

February 29, 1988

000

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 60017092A

July 8, 1983 1983JP-0125352

INT-CL (IPC): C25D 3/22

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 60017092A

BASIC-ABSTRACT:

A delustering additive compsn for an alkaline Zn electroplating soln. comprising (a) a quat amine polymer of formula (I) and (b) a quat. imidazole deriv. of formula (II). In the formulae R1 is 1-5C alkyl, or -CH2-CH(OH)-CH2- or CH2CH2OCH2CH2-; Xis a halogen ion; n is a polymerisation degree of 5-150. R2 and R3 are independently 1-5C alkyl, benzyl or HO-(CH2)m; m is 1-6.

The amt. of said polymer (I) to be added to the Zn plating soln. is pref. 50-1000 mg/l, and that of the deriv. (II) is pref. 0.1-5g/l.

USE/ADVANTAGE - Due to the addn. of both of (I) and (II), a delustered Zn platedsurface may be formed, having high rust-inhibitory effect.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: DELUSTERED ADDITIVE ALKALINE ZINC ELECTROPLATING SOLUTION COMPRISE

```
=> s jp60017092/pn
L1
           1 JP60017092/PN
=> d all
I.1
    ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2005 ACS on STN
AN
    1985:478319 CAPLUS
DN
    103:78319
ED
    Entered STN: 07 Sep 1985
ΤI
    Additives for satin finished zinc electroplating
PA
    Dipsol Chemicals Co., Ltd., Japan
SO
    Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 4 pp.
    CODEN: JKXXAF
DΤ
    Patent
LA
    Japanese
IC
    ICM C25D003-22
CC
    72-8 (Electrochemistry)
    Section cross-reference(s): 28
FAN.CNT 1
    PATENT NO.
                     KIND DATE
                                      APPLICATION NO.
                                                           DATE
    -----
                     ----
                                       -----
                                                             _____
    JP 60017092
                            19850128
                      A2
                                       JP 1983-125352
                                                           19830708 <--
                      B4
    JP 63009594
                            19880229
PRAI JP 1983-125352
                            19830708
PATENT NO. CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
JP 60017092 ICM C25D003-22
        \mathbf{x}^{-}
            II
```

ST zinc satin finish electroplating bath; imidazolium compd zinc electroplating; quaternary ammonium polymer zinc electroplating; bright zinc electroplating

IT Imidazolium compounds

RL: USES (Uses)

(halides, zinc with satin finish electroplating in bath containing quaternary ammonium compound polymer and)

IT Quaternary ammonium compounds, polymers

RL: USES (Uses)

(halides, zinc with satin finish electroplating in bath containing imidazolinium compound and)

IT 7440-66-6, uses and miscellaneous

RL: PEP (Physical, engineering or chemical process); PROC (Process) (electroplating of, with finish in bath containing quaternary ammonium compound polymer and imidazolium compound)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-017092

(43) Date of publication of application: 28.01.1985

(51)Int.CI.

C25D 3/22

(21)Application number : **58-125352**

(71)Applicant : **DEITSUPUSOOLE KK**

(22)Date of filing:

08.07.1983

(72)Inventor: IHARA YASUO

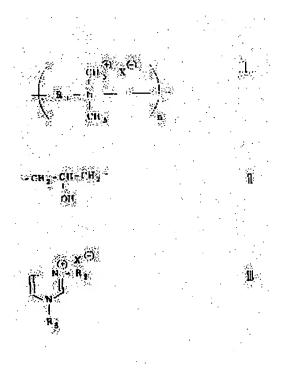
TAKAHASHI AKIO IGARASHI TOSHIO

(54) ADDITIVE FOR MAT ZINCIFICATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To form a mat zincified surface having superior rust preventing power by adding an additive consisting of a quaternized amine polymer and a quaternized imidazole deriv. each represented by a specified formula to an alkaline electrolytic zincifying soln.

CONSTITUTION: An additive is prepd. by mixing a quaternized amine polymer represented by formula I (where R1 is 1W5C alkyl, a group represented by formula Ilor -CH2CH2OCH2CH2-, X- is a halogen ion, and n is 5W150 degree of polym.) with a quaternized imidazole deriv. represented by formula III (where each of R2 and R3 is 1W5C alkyl, benzyl or HO(CH2)m, m is an integer of 1W6, and X- is a halogen ion). The prepd.



additive is added to an alkaline electrolytic zincifying soln. The concn. of the amine polymer in the soln. is 50W1,000mg/l, and that of the imidazole deriv. is 0.1W5g/l.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-17092

⑤ Int. Cl.⁴C 25 D 3/22

識別記号

庁内整理番号 7325-4K 砂公開 昭和60年(1985)1月28日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈艶消し亜鉛めつき用添加剤

願 昭58—125352

②出 願 昭58(1983)7月8日

⑫発 明 者 井原保雄

@特

調布市小島町2-55-1調布南

コーポラス902

⑫発 明 者 髙橋昭夫

木更津市久津間2017

仰発 明 者 五十嵐敏夫

東京都千代田区三番町9-1麴

町三番町マンション708号

⑪出 願 人 ディップソール株式会社

東京都中央区京橋3丁目2番17

号

四代 理 人 弁理士 中村稔

外4名

明細

(1) 一般式

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{5}^{\bigoplus} X^{\bigoplus} \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & &$$

(式中、R₁は炭素数 / ~5のアルキル基、 -CH₂-CH-CH₂- または-CH₂CH₂OCH₂CH₂-、X⁻ OH

はハロゲンイオン、 n は重合度で s ~ / s 0 で ある) の四級化アミンポリマーと、一般式

(式中、 R₂および R₅は独立して選ばれ、炭素数 ノ~5のアルキル恭、ペンジル基または HO(CH2)m(mは1~6の整数)、X^〇はハロゲンイオンである)の四級化イミダゾール誘導体とから成り、アルカリ性電気亜鉛めつき液に添加されることを特徴とする艶消し亜鉛めつき用添加剤。

(2) 前記亜鉛めつき液に対して、前記一般式(I)の四級化アミンポリマーが 50~ 1000 呵/ 6 の濃度で添加され、また、前記一般式(II)の四級化イミダゾール誘導体が 0.1~ 5 8 / 8 の濃度で添加されることを特徴とする特許財政の範囲第(1)項に配載の添加剤。

3. 発明の静和な説明・

産業上の利用分野

本発明は、配気亜鉛めつきの分野に関し、鮮述 すれば、アルカリ性観気亜鉛めつき液に添加され て鮹消し亜鉛めつき製面を供するととができる添 加剤に関する。

従来技術

艶消し金属めつき扱而(梨地めつき設而)を得 るために従来より用いられている技術としては梨 地ニッケルめつき法がある。このめつき液に特殊 な添加剤を添加させるか、または、微粉子を懸濁 させてニッケルと共析させることによつて光沢の 消失したニッケル表面を得ることによつて、防眩 (反々射性)と装飾(高級化)を図るものである。

しかしながら、亜鉛めつきは、従来より専ら防 **蟟を目的として行なわれており、鯖梢しめつき** (梨地めつき)の研究は全くなされていなかつた のが実状である。しかして、最近のデザイン仕様 の多様化に伴ない、亜鉛めつき製品に関しても、 防備力を有すると同時に無光沢泉面を呈する製品

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{5}^{\Theta}X^{\Theta} \\
 & I \\
 & I \\
 & CH_{5}
\end{array}$$
(1)

(式中、Riは炭素数/~5のアルキル茜、 -CH₂-CH-CH₂- 主たは-CH₂CH₂OCH₂CH₂-、X⁻ OH

はハロゲンイオン、nは頂台皮でち~150であ る)の四級化アミンポリマーと、一般式

(式中、R2はおよびR3は独立して選ばれ、炭素数 /~5のアルキル苺、ペンジル苺または HO -(CH₂)_m (mは/~6の整数)であり、X[⊙]は ハロゲンイオンである)の四級化イミダゾール勝 導体とから成り、アルカリ性電気亜鉛めつき液に 添加されることを特徴とする動消し亜鉛めつき用

の需要が次第に高まつている。例えば、光学器機 の内装には、防館と反々射性をの両機能を敷持す るととが要求される。そのような光学器機等の分 野においては、従来から防御と反々射性を目的と して艶消し塗装が広く行なわれているが、この方 法は、コスト高で且つ作業が煩雑であるという間 題を有している。

発明の目的

本発明の目的は、亜鉛めつきにおいて、鮪消し めつき段而を呈することができ、しかも防止力に おいても使れているめつき表面を得ることができ る低廉で簡単な手法を提供することにある。

発明の構成

本発明者は、本発明の上配目的は、アルカリ性 既気頭鉛めつき液に特定の化合物から成る添加剤 を用いることによつて達成されることを見出した。 かくして、本発明に従えば、一般式



添加剤が提供される。

本発明の添加剤を添加しためつき液を用いる電 気めつき操作により、良好な艶消し亜鉛めつき (梨地亜鉛めつき)が生成される過程そのものは 未だ不明な点が多く充分な説明はできないが、両 化合物の相互作用により広範囲の電流密度におい て光沢化が抑制されつつ、しかも防錆力の優れた めつき段面が得られるものと解される。

一般式(T)の四級化アミンポリマーは、従来より 光沢めつきを得る目的で使用されていた化合物に 比べて、重合度の大きい化合物であり、且つ、少 最添加されることによつて良好な艶消しめつきを 呈するという特徴を有する。一般式(I)の四級化プ ミンポリマーを加えるだけでも、めつき姿面の艶 消し効果はある程度得られるが、この場合には、 高電流密度の領域において、めつき表面の光沢化 が生じ、適用できる電流密度の範囲が狭くなる。 しかしながら、本発明に従えば、一般式(1)の四級 化アミンポリマーに加えて、一般式仰の四級化イ ミダゾール誘導体を添加することにより、高電流

発明の効果

本発明の添加剤が添加されたジンケート亜鉛めつき液またはシアン化亜鉛めつき液のどときアルカリ性亜鉛めつき液は、広範囲の電流密度における電気めつき操作により、従来からの光沢亜鉛めつき表面に同等以上の防鎖力を有し且つ反々射性

7

の表にまとめる。

突 施 例

以下、比較例と実施例を挙げて本発明を更に脱明する。

めつき浴組成として、 2nO , NaOH および
NaCN を含有する浴、並びに、 2nO および NaOH
を含有する浴に、本発明に従う一般式(I)の化合物
および一般式(I)の化合物を額類および 凝度を変え
て添加し、観流密度を変化させながらめつき操作
を行なつた。比較例として、一般式(I)の化合物
よび一般式(I)の化合物のみを加えためつき浴を用
いて、同様のめつき操作を行なつた。結果を下配

8

(77	4. 53							特別昭60-17	7092 (4)	
	成名 の命の での のの のの のの のの のの のの のの のの の	0	全体的に組作出 てあり、皮膜が 一部試落する	0.5-15	0.25 ~ 75	1-25.	0.5 - 20			
£1	(1)	巨	12.5	山	可上	世	비	-		
そり 対抗 時	裕成分	4	ZnO	1	判	· 4 @	मृह्			
:5	# 18 S	0./	ſ	0.1	47.	2.0	0.7			
一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	横	© - 24 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		CG G GG GG	A CH2CH2OH	# 16 # 4.202 # 4.202 # 4.203	e c e e c e e c e e c e e c e e c e			
	(8/2)	0.7	1	0.7	0.7	0.5	2.0			
一般状(!)の代や物		(GR ₂) ₂ O(GR ₂) ₂ -N CR ₃ (GR ₂) ₂ O(GR ₂) ₂ -N (GR ₂) ₂ -N (GR ₂) ₂ O(GR ₂) ₂ -N		CH2CH CH2-N OH CH3	(CH ₂) ₂ 0(CH ₂) ₂ -N CH CH 10-20	- CH2 CH2 - N CH3	(CH ₂), - CH ₃ - CH ₃			
‡ ‡	来 名 玄	米施の 名 つ	无 数 3	海 路 多 8	来 施 名 9	実施 例 施 10	奥施 例 K 11	-		
1 4113	<u>ا</u>		nv .	Γ			11	·		
東京学者もつ	のおったる国語 乾暖樹田 (A/dm²)	表面が全体的に 粗く・皮障が一 部脱落する。	0.5~ # 高電航部が光沢 化する。	0.25~20	0.25~/.5 ACK 4~20 /·5~4/4m ² では製粧が得ら れる	0.25~25	0.25~10	0.25~25	0.25~20	
	(8/6)	72.5	1回	구॥	平圓	귀	ゴル	山	五百	
おしき存組成	浴成分	ZnO NaOH NaCN	티	子姐	五	工匠	中	平圓	五面	
一般式団の化合物	(8/2)	ı	ı	1.0	用	2.0	2.0	0.5	0.5	
	私			но ² 1						
	蠳			CH2CH2CH2CH	4	4	4	θ. Gg	Φ' ∯.	
1	年	'		- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	(<u>c.</u>	亙	Œ	# Z - E	eżz-Ę	
	發展 (8/6)	I	0.7	中區	0.03	0.	0.7	0.7	0.05	
一般式(1)の化合物	松類		CH2CH CH2-N OH CH3	甲	· 回	н	म <u>च</u>	$\left(\frac{\operatorname{CH}_{2} \operatorname{CH}_{2} \operatorname{CH}_{2}^{-1}}{\operatorname{CH}_{3}} \right)_{40-70}$	CH ₂ CH CH ₂ -N OH CH ₃ CH ₃	
突施例	*	比較可 木 1	元 (2) (2)	·张 名 名 1	张 岳 2	8K 名 語 8Z 8	800 名	来 多 空 5	(A)	